

# pecvd设备 微波等离子化学气相沉积系统

产品名称	pecvd设备 微波等离子化学气相沉积系统
公司名称	上海耀他科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:那诺-马斯特 产地:美国
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号6幢101室JT4602 (注册地址)
联系电话	021-62318025 17317363700

## 产品详情

微波等离子化学气相沉积系统概述：NANO-MASTER PECVD系统能够沉积高质量的SiO<sub>2</sub>, Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>, 或DLC薄膜，至大可达6”直径的基片上，该系统采用淋浴头电极或中空阴极射频等离子源来产生等离子，具有分形气流分布的优势，样品台可以通过RF或脉冲DC产生偏压。并可以支持加热和循环冷却水的冷却.使用250l/sec涡轮分子泵及3.5 cfm的机械泵，腔体可以达到低至10<sup>-7</sup> torr的真空。

标准配置包含1路惰性气体、3路活性气体管路和4个MFC

带有气体分布系统的平面中空阴极等离子源使得系统可以满足广大范围的要求，无论是等离子强度、均匀度，还是要分别激活某些活性组份

系统可以覆盖广泛的可能性来获得各种沉积参数。

微波等离子化学气相沉积系统应用：

等离子诱导表面改性：就是通常所说的用等离子实现表面改性(如亲水性、疏水性等)

等离子清洗：去除有机污染物

等离子聚合：对材料表面产生聚合反应

沉积二氧化硅、氮化硅、DLC(类金刚石)，以及其它薄膜

CNT(碳纳米管)和石墨烯的选择性生长：在需要的位置生长CNT或石墨烯。

微波等离子化学气相沉积系统特点：

立式系统

自动上下载片，带预真空锁

不锈钢或铝制腔体

极限真空可达 $10^{-7}$ Torr

RF淋浴头，HCD或微波等离子源

高达6" (150mm)直径的样品台

RF射频偏压样品台

水冷样品台

可加热到的 $800^{\circ}\text{C}$ 样品台

加热的气体管路

加热的液体传送单元

抗腐蚀的涡轮分子泵组

z大可支持到8MFC

基于LabView软件的PC计算机全自动控制

菜单驱动，4级密码访问保护

完整的安全联锁

我公司主要经营各类真空镀膜微纳加工设备，包括薄膜沉积、刻蚀及清洗去胶设备等（ALD，PECVD，RIE，磁控溅射，热蒸镀，电子束，离子束，热真空试验，晶圆清洗机，PA-MOCVD）